

## ① 概要

FE電子銃を用いることにより、従来のEPMAでは不可能であった $1\mu\text{m}$ 以下の微小領域の定量分析や高倍率（5万倍）のマッピング分析を行うことが可能となりました。

## ② 主な仕様

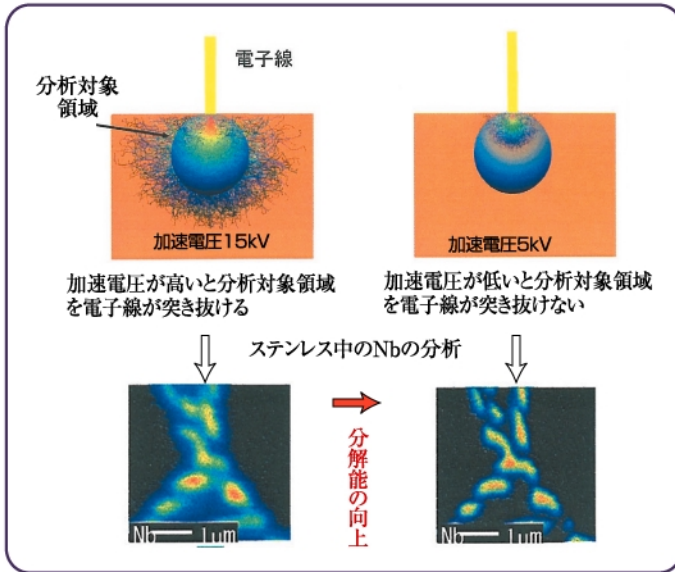
- (1) 分析元素範囲：5B～92U
- (2) 二次電子分解能：3nm
- (3) 分析時最小プローブ径：100nm (10kV,  $1 \times 10^{-7}\text{A}$ )

## ③ 特徴

- (1) 低加速電圧（5～10kV）下での分析により最小分析領域は約 $0.2\mu\text{m}$ となります。
- (2) 従来のEPMAが持つ「手軽で高精度な分析法」で $1\mu\text{m}$ 以下の分析が可能となり、EPMA分析の対象領域が大きくなりました。

## ④ 利用分野

- (1) エレクトロニクス実装品などの接合界面の成分調査
- (2) 金属材料中の微細介在物・析出物の調査
- (3) 表面処理皮膜の成分分布状況の調査



低加速電圧によるX線分解能の向上